В. В. ЛЫСАК

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ НА УСИЛЕНИЕ В ПОЛУПРОВОДНИКОВОМ ЛАЗЕРЕ

Развитие современных волоконно-оптических систем передачи информации невозможно без совершенствования конструкции и оптимизации параметров полупроводниковых лазеров. Эффективным способом разработки элементов и систем радиоэлектроники является компьютерное моделирование, которое позволяет в значительной степени сократить сроки и стоимость разработок.

Для моделирования динамических характеристик полупроводниковых лазеров в качестве базовых используются скоростные уравнения. Один из их основных параметров — оптическое усиление, которое определяется линейным коэффициентом оптического усиления $g = g_0(N - N_{th})$, где g_0 — дифференциальное усиление; N— плотность электронов; N_{th} — пороговая плотность электронов [1; 3]. С учетом нелинейного эффекта спектрального выжигания дыр коэффициент усиления записывают в различных формах представления [3-5]. Линейная форма усиления g правильно описывает реальное поведение лазера при малых токах накачки, однако, как показывают последние исследования, при больших значениях плотности электронов усиление насыщается, т.е. зависимость нелинейна[4], что обязательно должно учитываться в динамической модели.

Чтобы определить приемлемую форму представления коэффициента усиления в системе скоростных уравнений проанализируем влияние плотности носителей на оптическое усиление лазера с учетом влияния плотности носителей на величину квазиуровня Ферми.

Для анализа оптического усиления воспользуемся выражением, полученным из эффективных уравнений Блоха [5]:

$$G = \frac{\omega}{\varepsilon_0 n_r^2} \int_{E_g}^{\infty} dE \rho |\mu|^2 (f_c - f_v) \frac{\pi L(E - \hbar \omega)}{1 + (\tau_e + \tau_h)\pi L(E - \hbar \omega) |\mu|^2 \frac{\omega}{\varepsilon_0 n_r^2} S}, \quad (1)$$

Здесь ω — угловая частота; ε_0 — диэлектрическая проницаемость вакуума; E_g — ширина запрещенной зоны; n_r — коэффициент преломления на границе сред; c — скорость света; \hbar — постоянная План-

ка; т_е, т_h — время рекомбинации для электронов и дырок соответственно; *S* — плотность фотонов;

$$\rho = \frac{m_c \sqrt{2m_c (E - E_g)}}{\hbar^3 \pi^2} -$$
плотность состояний электронов,

где *m_c* — эффективная масса электрона;

$$L(E - \hbar\omega) = \frac{1}{\pi} \frac{\hbar\gamma_d}{(E - \hbar\omega)^2 + (\hbar\gamma_d)^2} - функция Лоренца,$$

где $\gamma_d = \frac{2}{\tau_e + \tau_h}$ — скорость рекомбинации диполя;

$$\left|\mu\right|^{2} = \frac{e^{2}\hbar^{2}\left|M\right|^{2}}{m_{0}^{2}E^{2}}, \left|M\right|^{2} = \frac{m_{0}}{6}\left(\frac{m_{0}}{m_{c}}-1\right)\frac{E_{g}(E_{g}+\Delta_{so})}{E_{g}+2\Delta_{so}/3}.$$
(2)

Здесь е — заряд электрона; m_0 — масса покоя электрона; Δ_{so} — спин-орбитальный момент; f_c, f_v — распределение Ферми для электронов и дырок соответственно,

$$f_c = 1/(1 + \exp(\frac{E_c - \mu_{Fc}}{k_B T})), \quad f_v = 1/(1 + \exp(\frac{E_v - \mu_{Fv}}{k_B T})), \quad (3)$$

где E_c, E_v — энергия дна зоны проводимости и вершины валентной зоны соответственно; μ_{Fc}, μ_{Fv} — энергия квазиуровней Ферми для электронов и дырок; k_B — постоянная Больцмана; T — температура.

Анализ выражения (1) показал, что коэффициент усиления нелинейно зависит от величины квазиуровня Ферми. Данная зависимость представлена на рис. 1. Из него видно, что при $\mu_{Fc} < 1,515$ эВ значения коэффициента усиления отрицательны, т.е. происходит поглощение энергии, при увеличении значения μ_{Fc} коэффициент меняет знак на противоположный — происходит излучение фотонов. Для определения зависимости коэффициента оптического усиления от концентрации рассмотрим влияние концентрации на величину μ_{Fc} :

$$N = N_c F_{\frac{1}{2}} \left(\frac{E_c - \mu_{Fc}}{k_B T} \right).$$
(4)

Здесь N_c — эффективная плотность состояний зоны проводимости; $F_{\frac{1}{2}}(\zeta)$ — интеграл Ферми — Дирака.

Имеют место соотношения



Рис. 1

Существуют приближенные аналитические выражения зависимости квазиуровня Ферми от концентрации, однако они справедливы только для определенных материалов, а нас интересует общее решение.

С использованием выражения (4) была найдена зависимость концентрации от величины квазиуровня Ферми и получен интерполяционный полином обратной зависимости. Результаты представлены на рис. 2. Сплошной линией показана кривая интерполяционного полинома, точками — расчетные данные. Как видно из рис. 2, решения интерполяционного полинома и расчетные данные совпадают.

Определив зависимость μ_{Fc} от N, подставим ее в выражение (3), а затем в (1) и отыщем зависимость коэффициента оптического усиления от концентрации электронов. Результаты сравнения полученной и линейной зависимостей даны на рис. 3. Сплошной линией показано решение для выражения (1), пунктирной — для линейной формы представления.

Значение пороговой концентрации $N_{th} = 1,1 \times 10^{24} \text{ м}^{-3}$, что согласуется с экспериментальными данными. Как видно из рис. 3, при значениях концентрации $N = 3,5 \times 10^{24} \text{ м}^{-3}$ происходит насыщение и наблюдается расхождение с выражением для линейной формы усиления.



Таким образом, зависимость коэффициента усиления от концентрации электронов при больших значениях N изменяется нелинейно, что правильно отражает реальное поведение полупроводниковых лазеров. Следовательно, для расчета динамических характеристик необходимо применять уточненное выражение (1) с использованием зависимости функции Ферми от концентрации.

Список литературы: 1. Agrawal G. P. Gain nonlinearities in semiconductor lasers: theory and application to distributed feedback lasers // IEEE J. Quant. Electron. 1987. N 6. P. 860 - 868. 2. Bowers J. E. Modulation properties of semiconductor lasers // ECE Technolody. Research in Optoelectronics (B). Santa Barbara, California, 1993. P. 109 - 141. 3. Tucker R. S. High-speed modulation of semiconductor lasers // J. of Lightware Tecnology. 1985. N 3. P. 1180 - 1192. 4. DeTemple T. A., Herzinger C. M. On the semiconductor laser logarithmic gain-current density relation // IEEE J. Quant. Electron. 1993. V. 29. P. 1246 - 1252. 5. Nonlinear gain coefficient in semiconductor lasers: effects of carrier heating / C.-Y. Tsai, R.M. Spencer, Y.-H. Lo, L.F. Eastman // IEEE J. Quant. Electron. 1996. N 2. P. 201 - 212.

Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники

Поступила в редколлегию 22.04.97